

# AccuZone -ZC2

フォトマスク用レジスト剥離 / 洗浄システム - アクキュ・ゾーン

オゾンガスによる、硫酸レスフォトレジスト剥離 & 洗浄システムです。

オゾンガスと温純水によるフォトレジスト剥離プロセスは、従来のSPMを使用したケミカル処理に置き換わる画期的なプロセスです。オゾン分子(O<sub>3</sub>)が分解して発生する(O<sub>2</sub> + O)酸素原子(O)は、C-H結合を持つ有機物に対して強力に作用します。さらに温純水がこの酸化された有機物を洗い流すため、ケミカルレスの剥離プロセスが可能なのです。

概要  
Overview

プロセス  
Process

システム  
SYSTEM

その他  
Other



不完全な剥離プロセス



AccuZone の剥離プロセス

## システムの特長

オゾンガス & 純水 ケミカル	<ul style="list-style-type: none"> <li>硫酸レス剥離洗浄処理のため、硫酸残渣によるヘイズ問題を解消します</li> <li>廃液の中和処理が不要です</li> <li>ケミカルサプライとミキシングのためのモジュールが不要です</li> </ul>
温純水	<ul style="list-style-type: none"> <li>反応速度を補助して剥離時間を短縮し、パーティクル除去を助けます</li> </ul>
モジュール構成	<ul style="list-style-type: none"> <li>MTC 標準モジュール、およびオゾンガス発生ユニット</li> </ul>
オゾンガス対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>完全密閉システム</li> <li>オゾン除去(廃液および排気)システムあり</li> </ul>